

离子束刻蚀 NIE-4000IBE离子束刻蚀系统 那诺-马斯特

产品名称	离子束刻蚀 NIE-4000IBE离子束刻蚀系统 那诺-马斯特
公司名称	上海耀他科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:那诺-马斯特 型号:NIE-4000 产地:美国
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号6幢101室JT4602 (注册地址)
联系电话	021-62318025 17317363700

产品详情

NIE-4000IBE离子束刻蚀系统概述：如铜和金等金属不含挥发性化合物，这些金属的刻蚀无法在RIE系统中完成。然而通过加速的Ar离子进行物理刻蚀则是可能的。通常情况下，样品表面采用厚胶作为掩模层，刻蚀期间富有能量的离子流会使得基片和光刻胶过热。除非可以找到有效的方式消除热量，否则光刻胶将变得非常难以去除。NANO-MASTER技术已经证明了可以把基片温度控制在50°C以内的同时，旋转晶圆片以达到想要的均匀度。

产品特点：

14.5"不锈钢立体离子束腔体

16cm DC离子枪1000eV,500mA, 气动不锈钢遮板

离子束中和器

氩气MFC

6"水冷样品台

晶片旋转速度3、10RPM，真空步进电机

步进电机控制晶圆片倾斜

手动或自动上下载晶圆片

典型刻蚀速率：铜200 $\mu\text{m}/\text{min}$, 硅：500 $\mu\text{m}/\text{min}$

6"范围内，刻蚀均匀度 $\pm 3\%$

极限真空 5×10^{-7} Torr，20分钟内可达到 10^{-6} Torr级别（配套500 l/s涡轮分子泵）

配套1000 l/s涡轮分子泵，极限真空可达 8×10^{-8} Torr

磁控溅射 Si_3N_4 以保护被刻蚀金属表面被氧化

基于LabView软件的PC计算机全自动控制

菜单驱动，4级密码访问保护

完整的安全联锁

我公司主要经营各类真空镀膜微纳加工设备，包括薄膜沉积、刻蚀及清洗去胶设备等（ALD，PECVD，RIE，磁控溅射，热蒸镀，电子束，离子束，热真空试验，晶圆清洗机，PA-MOCVD）